

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 6月 5日現在

機関番号:17104
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2010~ 2012
課題番号:22560203
研究課題名(和文) ナノ構造を利用したフォノン・電子の平均自由行程解析
研究理題名 (苗文) Evnerimental Analysis on Mean Free Paths of Phonons and Electrons
by using Micro-machined Nano-structures
研究代表者
宮崎 康次(KOJI MIYAZAKI)
九州工業大学・大学院工学研究院・教授
研究者番号:70315159

研究成果の概要(和文):本研究は、ナノ構造で材料の熱物性を制御する際に必要となるフォノンと電子の平均自由行程を MEMS 技術で作製したデバイスにより測定することを図った.数 µm 程度の孔を多数有する Si 薄膜を生成し、その熱伝導率を測定したところフォノンの平均自由行程が電子のものより長く、見かけの熱伝導率が従来の拡散輸送の式で説明できない結果を得た. さらにその長さを古典的なフォノン輸送の式で見積もったところ、室温付近で 3µm 程度と比較的長い結果が示され、電子の平均自由行程より長いことも明らかとなった.

研究成果の概要 (英文): We intend to measure the mean free paths of phonons and electrons by using micro-machined Si thin films with micro-holes. The thermal conductivities of the micro-structured Silicon were measured, and the measured values can be explained by the classical transport model. The mean free path of phonons is calculated to be about 3µm by Fucks-Sondheimer model, and it is longer than that of electrons.

交付決定額

(金額単位:円) 直接経費 間接経費 計 合 2010年度 1, 300, 000 390,000 1,690,000 1, 100, 000 330,000 1.430.000 2011 年度 2012 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 0 年度 0 0 年度 0 0 0 3, 400, 000 1.020.000 総 計 4, 420, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・熱工学

キーワード:マイクロ・ナノスケール伝熱,熱伝導,フォノン,電子,熱電発電

1. 研究開始当初の背景

新材料開発やシステムの改善など様々な 面からエネルギ変換技術の高効率化が取り 組まれてきたが、ナノテクノロジにより電気 的特性,熱的特性が制御でき、近年では太陽 光発電や熱電発電の高効率化に関する優れ た成果が次々と報告されている.ナノテクに よる発電素子の高効率化の流れの中、我々も ナノ多孔構造を利用した超断熱技術を利用、 フォノン輸送数値解析、熱輸送モデルの構築、 ナノ構造の作製とその熱物性測定を通した 熱電発電の高効率化に取り組んできた.しか し高効率化の壁となっているのが,電子輸送 の予測以上の低下である.作製手法によって は、フォノン輸送よりも電子輸送のほうが大 幅に低減することから、フォノンの平均自由 行程だけでなく、電子の平均自由行程を明確 にする手法の確立が必須となっている.

2. 研究の目的

これまで熱輸送を担う格子振動(フォノン)のほうが電流となる電子よりも,平均自 由行程が長いため,ナノ構造の影響を受けや すいとされてきた.実際に熱電発電の高効率 化に関する報告や我々の成果を検討しても, 熱電半導体では室温付近でおおよそ 100nm 程度と極めて長いフォノンの平均自由行程 が導かれる.本研究では,MEMS 技術によ り制御された構造の熱伝導率,導電度を測定 し,それら測定結果から,輸送係数低減を予 測するモデルを構築し,さらにフォノンなら びに電子の平均自由行程を得る手法の確立 を目的とする.

3. 研究の方法

一般的な MEMS 技術を利用して, 微細構造 を制御した Si 薄膜を生成し(図1), 通電加 熱することで, Si 薄膜の見かけの熱伝導率と 導電率を測定する.図1(e)のプロセスでは, KOH によるウェットエッチングで背面の Si を取り去る際に表面を SiO₂ で保護している. その際に働く残留応力で厚さ 2µm の Si 薄膜 に亀裂が入るため, SiN_x膜を生成して多層膜 とすることで, 残留応力を緩和した.最後は, Si 単体の薄膜とするため, Si 表面に残る酸化 膜,窒化膜をドライエッチングで取り除いた. Si 薄膜の平面形状は,4端子法による導電度 測定を行えるよう設計している.



(a) SOI ウエハ



(b) SiO₂マスク生成 とイオンドープ





Si SiO₂

(c) Si パターン生成

図 1 多孔 Si 薄膜生成プロセス概略



作製した形状を走査型電子顕微鏡(SEM)で 観察して,膜厚,幅,長さ,孔サイズ,孔配 置を把握する. その上で薄膜に電流を印加し て自己発熱させ,同時に電気抵抗を測定する ことで平均温度上昇を測定し、導電度、熱伝 導率を同時測定した.熱伝導率測定について は、レーザー周期加熱法による方法(図2) も試みて、測定結果をダブルチェックした. レーザー周期加熱法では,薄膜の一端を周期 加熱し、温度拡散率 a の大きさに対応して、 薄膜他端に遅れて到達する温度情報から温 度拡散率を得る測定法である.他端の温度上 昇を測定するため、Cu-Ni 薄膜熱電対をサン プル上に作製した.得られた温度拡散率に対 して,熱容量にバルク状 Siの値を仮定して, 見かけの熱伝導率を得て、さらに現象を考察 した.

4. 研究成果

図3に作製したデバイスのSEM像を示す. 鳥瞰図(a)に示すようにSi薄膜は自立して浮いた形となっており,根元部には曲率をつけることで応力集中を防ぐ工夫をした.Si薄膜の厚みはSEM観察結果より2µmであり,Si薄膜を流れる熱が膜面内方向にのみ伝わるよう,形状を工夫している.孔を全く持たないSi薄膜をreference 膜として,パターン1を格子状孔配置,パターン2を格子状孔配置で孔サイズを大きくしたもの,パターン3を



図3 生成した多孔 Si 薄膜の SEM 像. (a)鳥瞰 図, (b)格子状孔配置(c)孔径大(d)千鳥状孔配置



図4 測定された多孔 Si 薄膜の導電度

孔サイズはパターン1と同じとして、配置を 千鳥状にしたものを作製した.ウエハごとに 不純物濃度も異なるため、上記4つのパター ンを同じウエハ上に生成した.孔を配置させ たサンプルは、孔を生成する領域を調整して、 膜全体として空隙率が同じになるよう設計 している.SEM 観察結果からは 33%であった.

導電度の測定結果を図 4,熱伝導率測定結 果を図5に示す.横軸は測定平均温度,縦軸 は孔のない Si 薄膜の物性値との比となって いる. 3~4µm オーダーの微細構造に対し,見 かけの導電率は、ほぼ同じ値を示している. 空隙率 33%を仮定して得た見かけの導電率 を Maxwell の式として実線で示している.パ ターンの違いに関わらず、測定の温度範囲で おおよそ解析値と一致しており、電子の輸送 が拡散的であることを示しており, 3µm より も圧倒的に電子の平均自由行程が短いこと を示している.一方で測定された熱伝導率は, 拡散輸送を仮定して導かれる Eucken の式の 予測値よりも低い値を示している. これは熱 の輸送が準弾道輸送であり, 孔構造の影響を 強く受けていることを示している. すなわち Siのフォノンの平均自由行程は、3~4 um より も長いことを示しており、特にパターン3の 千鳥状孔配置の熱伝導率が最も小さくなっ ていることとも矛盾しない. 温度依存性につ いてもフォノンの平均自由行程が低温にな るほど伸びることが知られており、どの孔配 置をもつ形状でも,熱伝導率が構造によって 低下する効果が低温で強く表れた.

上記の見かけの熱伝導率測定が妥当であ るか検証するため、レーザー周期加熱により 温度拡散率を測定した結果を図6に示す.ど の測定も室温で行った.横軸は加熱位置と温 度測定位置の距離,縦軸に加熱と温度上昇の 位相遅れを示しており,曲線の傾きから熱拡



図5 測定された多孔 Si 薄膜の熱伝導率



図 6 レーザー周期加熱により測定された

温度拡散率

散率 a が計算できる (a = pf /(hf /hL)²). ポー ラス無しの薄膜の熱拡散率に対して,比熱, 密度をバルク値と同じと仮定すると、薄膜の 熱伝導率はおよそ 89W/(m·K)に相当し、バル ク状 Si の熱伝導率の 6 割程度となる. この結 果に対して Fucks-Sondheimer の式を使い、薄 膜表面で完全にフォノンが拡散反射してい ることを仮定すると,フォノンの平均自由行 程は 3µm と計算され,先の多孔 Si 薄膜の熱 伝導がフォノンの準弾道輸送によることを 支持する結果となっている. さらに測定され た温度拡散率から孔のある薄膜の熱伝導率 を求め、孔のない薄膜の熱伝導率との比を計 算すると、パターン1のものを除き、自己発 熱で得た熱伝導率測定結果とほぼ一致し、本 研究における熱伝導率測定の妥当性も確認 できた.しかし、自己発熱法で得たパターン 1の熱伝導率は、レーザー周期加熱法で得た 熱伝導率より、大きい値が得られており、引 き続き、熱伝導率と導電度を同時測定できる 自己発熱による熱伝導率測定の測定精度を 高める課題も浮き彫りとなった.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

- ① <u>Koji Miyazaki</u>, Saburo Tanaka, and Daisuke Nagai, Heat conduction of a porous material, Journal of Heat Transfer, 査読有, Vol.134, No.5, 051018 (2012).
- ② Harutoshi Hagino, Yosuke Kawahara, Aimi Goto, and <u>Koji Miyazaki</u>, Simultaneous measurements of thermal conductivity and electrical conductivity of micro-machined Silicon films, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 査読有, Vol.31, 012020, (2012).
- 永井大資,<u>宮崎康次</u>,塚本寛,分子動力学 法を用いたナノポーラス構造Siにおける 熱伝導解析,日本機械学会論文集 B 編, 査読有, Vol. 76, pp.1879-1883 (2010).
- ④ <u>宮崎康次</u>, MEMS を利用した温度測定, 日本機械学会論文集C編,査読有, Vol. 76, pp.1890-1892 (2010).

〔学会発表〕(計12件)

- 川原庸資,岩田尚,萩野春俊,<u>宮崎康次</u>, レーザー周期加熱によるSi薄膜の面方向 熱伝導率測定,日本機械学会九州支部 第66期総会・講演会,2013年3月13日, 福岡.
- ② Yosuke Kawahara, Harutoshi Hagino, Hisashi Iwata, and Koji Miyazaki, In-plane Thermal and Electrical Conductivity of Si Thin Film with Periodic Microporous, International Forum on Heat Transfer 2012, 2012 年 11 月 13 日,長崎.
- ③ 川原庸資,萩野春俊,岩田尚,<u>宮崎康次</u>, 多孔 Si 薄膜の熱・電気輸送特性,第 33
 回日本熱物性シンポジウム,2012 年 10 月 3 日,大阪.
- ④ Harutoshi Hagino, Yousuke Kawahara, Hisashi Iwata, and Koji Miyazaki, Effects of Micro-Structures on In-plane Thermal Conductivity and Electrical Conductivity of Silicon Thin Film, 18th Symposium on Thermophysical Properties, 2012 年 6 月 24 日, Boulder.
- ⑤ 萩野春俊,川原庸介,後藤愛美,<u>宮崎康</u> <u>次</u>,多孔薄膜 Siの面方向熱伝導率と電気 伝導率測定,第49回日本伝熱シンポジウ ム,2012年5月30日,富山.
- ⑥ Harutoshi Hagino, Yousuke Kawahara, Aimi Goto, Toru Hiwada, and <u>Koji Miyazaki</u>, In-Plane Thermal Conductivity and Electrical Conductivity Measurements of Silicon Thin Film, The Eighth KSME-JSME Thermal and Fluids Engineering Conference, 2012 年 3 月 18 日, Inchon.
- ⑦ 萩野春俊,川原庸介,後藤愛美,檜和田 徹,<u>宮崎康次</u>,薄膜Siの面方向熱伝導率

と電気伝導率の同時測定,日本機械学会 九州支部第 65 期総会講演会,2012 年 3 月 16 日,佐賀.

- ⑧ Harutoshi Hagino, <u>Koji Miyazaki</u>, In-plane Thermal Conductivity of Silicon Thin Films with Periodic Micro-pores, 7th US-Japan Joint Seminar on Nanoscale Transport Phenomena -Science and Engineering-, 2011 年 12 月 11 日, 伊勢志摩.
- ⑨ Koji Miyazaki, Heat Conduction in a Nano-Porous Material and its Application, ASME 2011 9th International Conference on Nanochannels,Microchannels,and Minichannels, 2011 年 6 月 19 日, Edomonton.
- 10 萩野春俊,永井大資,檜和田徹,<u>宮崎康</u> <u>次</u>,薄膜Siの面方向熱伝導率と電気伝導 度の同時測定,第48回日本伝熱シンポジ ウム,2011年6月1日,岡山.
- <u>宮崎康次</u>, Zheng Yanqiong, 久保脇勇貴, 柏木誠, 自己組織化ポーラス有機薄膜生 成, 日本機械学会中国四国・九州支部 徳島講演会, 2010年10月16日,徳島.
- ② 永井大資, 宮崎康次, 萩野春俊, 分子動 力学法を用いた多孔ナノ構造Siの熱伝導 解析, 第2回マイクロ・ナノ工学シンポ ジウム, 2010年10月13日, 松江.

〔図書〕(計2件)

- 鈴木雄二 他 54 人, NTS, 環境発電ハン ドブック, 2012, pp.174-180.
- ② 舟橋良次 他 42 名, CMC, 熱電変換技術の基礎と応用 ークリーンなエネルギー社会を目指して-, 2011, pp.309-324.

[その他]

ホームページ等 <u>宮崎康次</u>熱デバイス研究室 http://www.mech.kyutech.ac.jp/tdl/

6.研究組織
(1)研究代表者

宮崎 康次(KOJI MIYAZAKI)

九州工業大学・大学院工学研究院・教授研究者番号:70315159